

# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication nun	iber: <b>0</b> 4	136	95	77	Α
----------------------	------------------	-----	----	----	---

(43) Date of publication of application: 22.12.92

(51) Int. Cl B41M 5/26 G11B 7/26

(21) Application number: 03147293

(22) Date of filing: 19.06.91

(71) Applicant:

MITSUI TOATSU CHEM INC

(72) Inventor:

YOKOTA CHIAKI

MOMOTAKE HIROYUKI SASAGAWA TOMOYOSHI

ASAMI TAKUO

# (54) MANUFACTURE OF OPTICAL RECORDING MEDIUM

# (57) Abstract:

PURPOSE: To obtain an optical recording medium which eliminates the generation of blisters and allows a recording layer to stick to a reflective layer closely by controlling a residual solvent density.

CONSTITUTION: The subject optical recording medium consists of a recording layer, a reflective layer and a protecting layer provided in that order, on a substrate. The reflective layer is formed, if the residual solvent amount contained in the recording layer is 10wt.% of lower compared to the total weight of the recording layer. Further, the recording layer 2 where pits are formed by absorption of a laser beam is provided on the transparent substrate 1 where a pre groove formed. In addition, the reflective layer 3 for increasing a reflection factor is provided on the recording layer, and the protecting layer 4 for protecting the recording layer and the reflective layer is provided on the reflective layer 3.

COPYRIGHT: (C)1992,JPO&Japio

 <del></del>
4
 3
a
1

(19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平4-369577

(43)公開日 平成4年(1992)12月22日

. 技術表示箇所 織別記号 庁内整理番号 FI (51) Int.Cl.\* B41M 5/26 7215-5D G11B 7/26 8305 - 2H B41M 5/26 審査請求 未請求 請求項の数4(全 5 頁) (71)出額人 000003126 (21)出願番号 特顧平3-147293 三井東圧化学株式会社 東京都千代田区霞が隣三丁目2番5号 平成3年(1991)6月19日 (22)出康日 (72)発明者 横田 千秋 神奈川県横浜市朱区笠間町1190番地 三井. 東圧化学株式会社内 (72)発明者 百武 宏之 神奈川県横浜市柴区笠間町1190番地 三井 東圧化学株式会社内 (72)発明者 笹川 知由 神奈川県横浜市栄区笠間町1190番地 三井 東圧化学株式会社内 最終頁に続く (54) 【発明の名称】 光記録媒体の製造方法 (57)【要約】 【構成】 基板上に記録層、反射層、および保護層がこ の順に設けられた光記録媒体の製造方法において、フタ ロシアニン色素から成る記録層中に含まれる残留溶媒量 が、記録層に対して特定量以下の時に反射層の成膜を行 う光記録媒体の製造方法。 【効果】 基板と記録層との密着性を高め、また、記録 **贈と反射層の界面にできる水池(ブリスター)の発生を** 大きく抑えることが可能となる。

- 1 ##
- 2 紀緯用
- 3 KMM
- 4 何望用

(2) 🐣

特開平4-369577

## 【特許請求の範囲】

【請求項1】 善板上に記録階、反射廠、および保護層 がこの順に設けられた光記録媒体の製造方法において、 記録層中に含まれる残留溶媒量が、記録層に対して10 重量%以下の時に反射層の成膜を行うことを特徴とする 光紀録媒体の製造方法。

【顔求項2】 上記紀録層がフタロシアニン色素を含む ことを特徴とする請求項1記載の光記録媒体の製造方 抾.

【請求項3】 記録層中に含まれる残留溶媒量を、記録 層に対して2重量%以下とする請求項1記載の光記録媒 体の製造方法。

【鯖求項4】 請求項1ないし3のいずれかの方法によ り製造された光記録媒体。

## 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、光記録媒体、特に金属 反射層を有する単板形光記録媒体に関する。

#### [0002]

【従来の技術】近年の急速な情報化社会の進展に伴い、 磁気記録媒体に比べ格段に高密度記録が可能な光記録媒 体の利用・研究が盛んに行われている。この光記録媒体 としては、あらかじめ情報が記録されており再生のみが 可能な再生専用型、利用者によって情報の記録および再 生が可能な追記型、および情報の記録・再生・消去が可 能な書換え型が知られている。なかでも追記型は、書換 え型よりも一般に安価で保存性に優れるため、大量のデ ータをコンパクトに保存しておく媒体として広く普及し つつある。この追記型の光記録媒体は、Te、Biなど の金属膜や、シアニン、フタロシアニンなどの色素膜等 を基板上に記録層としてもっており、レーザー光を照射 してこの記録層に物理的および/あるいは化学的変化を 起こさせてピットを形成することによって情報を記録 し、このピットを配録時よりも十分に弱いレーザー光に よって読みだして再生を行うものである。このような光 紀録媒体では、ピット形成を容易にするため紀録層上に 空間を確保するのが一般的である。具体的には、記録層 をもった基板2枚を、記録層が対向しかつ2枚の基板の 間に空隙ができるように貼り合わせた、いわゆるエアサ ンドイッチ構造がとられる。

【0003】一方、再生専用型の光記録媒体が、コンパ クトディスク (CD) やレーザーディスクなどとして広 く一般に普及しているのは周知の通りである。この光記 緑媒体の構造を図1に示す。この光記録媒体は、あらか じめ基板1にピットを形成しておき、そのピット形成面 にAu、Al等の金属層を反射層3として設け、さらに その上に保護層4を形成したものである。なかでもCD は、これまでの音楽レコードに比べ取り扱いやすく半永 久的に使用できるという利点から、わが国においてはレ

利用されるにつれて、このCDの再生装置であるコンパ クトディスクプレーヤー (CDプレーヤー) もレコード プレーヤーに肩を並べるほど広く普及している。このよ うにきわめて広く普及しているCDは、一般にスタンパ 一と呼ばれる原盤をもとにして射出成形によって情報ビ ットをもつ基板を作製する。この方法では同じCDを大 量にかつ安価に製造することは容易であるが、スタンパ 一が高額なため、小量のCDを作製することには向いて いない。また当然のことながら、CDは再生専用である ため、利用者が自由に音楽や情報を記録することは不可 能である。そこで、小量のCDを安価に作製するため、 あるいは利用者が自由に記録を行うための、記録可能な CD(追配型CD)の開発が盛んに行われている。

【0004】最近、提案された追記型CDは、図2に示 すような構造になっている。すなわち、基板1上に記録 層2を設け、その上に反射層3を設けて、さらにその上 に保護層4を設けた単板型の光記録媒体である。このよ うな構造にすることによって、紅緑後の追記型CDが通 常の再生専用CDと互換性をもつことが可能になる。す 20 なわち、エアサンドイッチ型構造ではなく単板型構造に することによってその厚さを1.2mmという薄さにす ることが可能になる。また、反射層を設けることによ り、再生専用CDと同等の反射率70%以上を獲得する ことが可能となるとする。

# [0005]

【発明が解決しようとする課題】従来の記録層の成膜方 法としては、有機系色素を適当な溶媒に溶かし、プリグ ループ(案内溝)を形成した透明な基板の上に塗布する 方法を用いている。強布した配録層は適当な乾燥工程を 経た後、反射層をその上に形成しているが、従来の有機 色素系の配録層をプラスチック基板上に有する遺紀形で Dにおいては、反射層と記録層との密着性が弱く、ま た、媒体を高温、高温度下の条件に長時間 放置した場 合、プリスターと呼ばれる記録層と反射層の界面にでき る水泡(以下プリスターと呼ぶ)が、特にレーザーで配 録された部分に多く発生し課題とされていた。一般に記 録層に記録する時、反射層と記録層との密着性の低下 や、このプリスターの発生は、読み取り時の信号のC/ N比や二次高額波歪に影響を与え、ジッターやブロック 40 エラーレートの増大につながる。そのため、反射層と記 **贔層との密着性を高め、プリスターの発生を抑えること** が記録特性の向上に必要である。

#### [0006]

【課題を解決するための手段】本発明者らは、上記課題 を解決すべく鋭意研究を重ねた結果、反射層を形成する 際に、記録層に含まれる残留溶媒量を特定の値以下に減 らしておくことによって、基板と記録層との密着性を高 め、紀錄時のブリスターの発生を大きく抑えることが出 来ることを見出し、本発明に至ったものである。すなわ コードにとって代わりつつある。このようにCDが広く 30 ち、本発明は、基板上に記録僧、反射層、および保護層

がこの順に設けられた光記録媒体の製造方法において、 紀録層中に含まれる残留溶媒量が、記録層に対して10 重量%以下の時に反射層の成膜を行うことを特徴とする 光記録媒体の製造方法、を要旨とするものである。

【0007】以下、本発明の構成要件を詳細に説明す る。本発明の光記録媒体の構成は図2に示した追記型C Dと基本的に同一である。すなわち、プリグループを (案内溝)を形成した透明な基板1の上にレーザー光を 吸収してピットを形成する記録層2が設けられており、 その記録層の上に反射率を増大させるための反射層3が 設けられており、さらにその上に記録層および反射層を 保護するための保護層4が設けられているものである。 上記基板の材質としては、半導体レーザーの光を実質的 に透過し、適常の光記録媒体に用いられる材料ならば、 いかなるものも使用できる。たとえば、ポリカーポネー ト樹脂、アクリル樹脂、ポリスチレン樹脂、塩化ピニル 樹脂、エポキシ樹脂、ポリエステル樹脂、アモルファス ポリオレフィンなどの高分子材料、あるいはガラスなど の無機材料等を利用できる。これらの材料を射出成形に よって、あるいは2P法などによってプリグループを形 成した基板とする。

【0008】記録層は記録レーザー光を吸収して物理的 及び/あるいは化学的変化を起こし、再生レーザー光で その形状変化を読み取ることが可能であるような物質で あれば特に限定されない。たとえば、半導体レーザー波 長城に吸収を有する以下のような各種の有機色素を用い ることができる。すなわち、フタロシアニン系色素、ナ フタロシアニン系色素、シアニン系色素、スクワリリウ ム系色素、ピリリウム系色素、チオピリリウム系色素、 アズレニウム系色素、ナフトキノン系色素、アントラキ ノン系色素、N I. Crなどの金属塩系色素、インドフ ェノール系色素、トリフェニルメタン系色素、キサンテ ン系色素、インダンスレン系色素、インジゴ系色素、チ オインジゴ系色素、メロシアニン系色素、チアジン系色 素、アクリジン系色素、オキサジン系色素、アソ系色素 などを挙げることができる。なかでも、フタロシアニン 系色素はその高い耐光性・耐久性から特に好ましいもの である.

【0009】これらの色素は単独で用いてもよいし、2 種類以上の色素を混合して用いてもよい。また、必要に 応じて紫外線吸収剤、一重項酸素クエンチャー、結合剤 等の添加物質を加えることもできる。これらの物質を、 上記基板上に均一な膜として成膜し、記録層を形成させ る。このとき、反射膜を形成後に十分な反射率が得られ るように、あらかじめ記録層の膜厚および光吸収成分の **濃度を調整することが好ましい。この記録層を形成する** 方法としては、スピンコート法、ディップコート法、パ ーコート法などの強布法を用いることができる。これ は、記録層として用いる物質を溶剤に溶解して堕布液を 調整し、これを上記基板上に強布後、乾燥して成膜する 50 いが、通常30~500nm程度である。

ものである。このときの密剤としては、以下のような各 種有機溶剤が利用可能である。 すなわち、 n - ヘキサ ン、n‐オクタン、イソオクタン、シクロヘキサンなど の脂肪族炭化水素;トルエン、キシレンなどの芳香族炭 化水素: 1. 2-ジクロロエタン、クロロホルムなどの ハロゲン化炭化水素:メタノール、エタノール、イソブ ロパノールなどのアルコール:ジエチルエーテル、ジブ チルエーテル、ジオキサンなどのエーテル:メチルセロ ソルプ、エチルセロソルプなどのセロソルプ:メチルエ チルケトン、シクロヘキサノンなどのケトン:酢酸エチ ル、酢酸プチルなどのエステル:2、2、3、3-テト ラフルオロプロパノールなどのフッ素化アルコールなど を用いることができる。これらの有機溶剤は単独で用い てもよいし、混合して用いてもよい。また、これらの溶 剤を用いる場合、記録層として用いる物質を溶解するだ けでなく、このとき用いる基板に対してダメージを与え ないものを選択する必要があることは言うまでもない。

【0010】本兇明においては、有機系色素に対する上 記溶媒の残存量が、記録層中に10重量%以下の条件 で、反射層の成膜を行う必要がある。この溶媒残存量が 10重量%よりも大きい時に成膜を行うと、媒体を高 温、高湿度下の条件に長時間放置した場合、記録層と反 射層の界面においてプリスターの発生率を大幅に増大さ せてしまう。また、このとき反射層と記録層の密着性が 悪化し、反射層が剝離しやすくなってしまう。このよう なプリスターの発生や剥離が起こった場合、信号の記録 ・再生が不可能になり重大な問題を引き起こす。本発明 において、高温、高温度下の条件に長時間放置した場合 の記録層と反射層界面でのプリスターの発生は、溶媒残 存量を記録層に対して特に2重量%以下に規定すること によってほぼゼロに抑えることができる。

【0011】この有機系色素中の溶媒残存量を本発明で 規定する条件下にコントロールすることは、通常は、単 に自然放置しただけでは、達成することはかなり困難で ある。したがって、成膜後の乾燥条件を、適切にコント ロールすることが重要である。例えば、配録層盤布後 に、真空乾燥、送風乾燥、あるいは高温乾燥等を、意図 的に行うことによって、初めて記録層中の溶媒の残存量 を本発明で規定する範囲になるように、関節することが できるのである。この条件は容易に実験的に決定するこ とが可能である。残留溶媒を測定するには、記録器を剥 離して乾燥減量を求める方法、また、赤外分光法により ピーク強度比から求める方法、別の溶媒に溶解してガス。 クロマトグラフィーにより定性、定量することが可能で ある。したがって、もし、ある乾燥条件下で、溶媒残存 量が本発明で規定する範囲まで充分減少しなかった場合 は、所望の残存量になるまで、分析を行いながら、さら に乾燥を継続して、乾燥条件を決定すればよいのであ る。なお、紀録層の膜の厚みは特に展定するものではな

40

(4)

【0012】紀録層上には、金属の反射層を形成する。 この反射層は、単一金属のみから成っていてもよいし、 他の元素を1種類あるいは2種類以上副成分として含ん でいてもよい。この成分元素としては、例えばAu、A g、Al, Cu, Cr. Nl, Si, Ge等を挙げるこ とができる。この反射層を形成する方法としては、真空 養着法、スパッタ法、化学蒸着法 (CVD) などの方法 を用いることが可能である。反射層の厚みは、通常、3 0~500mm程度である。反射層上には、保護層を設 ける。この保護層は記録膜および反射膜を保護できるも 10 のならば特に限定されない。たとえば、ポリカーポネー ト、アクリル、ポリスチレン、塩化ピニル、エポキシ、 ポリエステルなどの高分子材料、あるいはSiO。、A 1: O」、AINなどの無機物を用いることができる。 なかでも、紫外線硬化アクリル樹脂は、容易に保護層を 形成できるので好適である。これらは、単独で用いても よいし、混合して用いてもよい。また、多層膜として2 種以上を重ねて使用しても構わない。保護層の厚みは、 3~50μm 程度である。

#### [0013]

# 【実施例】以下本発明の実施例を示す。

[実施例1] バナジル・テトラオクチルナフタロシアニ ン色素 0. 6gをn-オクタン20mlに溶解し、虚布 溶液を調製した。この溶液をスパイラルグループ付きの ポリカーポネート製射出成形基板(外径120mm、厚 さ1、2mm、トラックピッチ 1、6 μm) 上に回転数 ... 1200 грmでスピンコートした後、真空度1×10 "torr、50℃で12時間真空乾燥し、記録層を1 20 nm形成した。この記録層中の残留溶媒量を測定す るため、上記記録層を有する基板1枚をクロロホルム5 0mlに30秒間浸し、クロロホルム中に有機系色素層 を溶出させ、この溶液のガスクロマトグラフ測定を行っ た、その結果、記録層に対して残留溶媒が2重量%存在 することが確認された。さらに同じ基板を用いて、記録 層上に厚さ90 nmの純粋なAu模を形成した。さらに この反射層上に紫外線硬化樹脂をスピンコート後、紫外 線を照射し硬化させ、厚さ4μmの保護層を形成した。 このようにして作製した光記録媒体に、光ディスク評価 装置DDU-1000(パルステック工業製、レーザー 波長78lnm) およびEFMエンコーダー (KENW 40 OOD (株) 製) を用いて、線速度1、4m/s・記録 レーザーパワー 7mWで記録した。記録媒体を温度80 ℃、湿度85%の低温恒温層で2000時間、耐湿熱試 験を行った後、光学顕微鏡でディスク表面を観察したと ころ1cm×1cm四方にはブリスターは確認されなか った。また、粘着テープ (Scotch B10) を用 いて、この媒体の剥離試験を行ったが、反射膜の剥離は 観測されなかった。

【0014】 [比較例1] 実施例1に対して、スピンコ 一ト後に真空乾燥を行わずに光記録媒体を作製し信号を 50 3 反射層

記録した。この比較例において、記録層を形成した後に 実施例1と同様に残留溶媒測定を行ったところ、記録層 に対して残留溶媒が11重量%存在することが確認され た。実施例1と同様にプリスター観察を行った結果、1 cm×1cm四方に53個のブリスターが確認された。 また、剥離試験を行ったところ、反射膜と配録膜の間で 到離し、粘着テープとともに反射膜および保護膜が剝が れてしまった。

【0015】 [実施例2] シアニン色素NK529 (日 本感光色素) 0.41gをメチルセロソルブ10mlに 溶解し、筺布溶液を調製した。この溶液をスパイラルグ ループ付きのポリカーポネート製射出成形基板(外径1 20mm、厚さ1.2mm、トラックピッチ1.6μ m)上に回転数1000rpmでスピンコートした後、 オープンで60℃、12時間送風乾燥し、記録層を12 0 n m形成した。この記録層の残留溶媒測定を実施例1 と同様に行ったところ、記録欄に対して残留溶媒が10 重量%存在することが確認された。次に、上記記録層上 に厚さ80mmの純粋なAu膜を形成した。 さらにこの 反射層上に紫外線硬化樹脂をスピンコート後、紫外線を 照射し硬化させ、厚さ4μπの保護層を形成した。この ようにして作製した光記錄媒体に、記録レーザーパワー 7. 5mWで実施例1と同様にして記録した。また、実 施例1と同様に耐温熱試験を行った後、光学顕微鏡でデ ィスク表面を観察したところ1cm×1cm四方に6個 プリスターが確認された。また、粘着テープ(Scot ch 810)を用いて、この媒体の剥離試験を行った が、反射膜の剥離は観測されなかった。

【0016】 [比較例2] 実施例2に対して、スピンコ 一ト後に送風乾燥を行わずに光記録媒体を作製し信号を 記録した。この比較例においても、記録層を形成した後 に実施例1と同様に配録層の残留溶媒測定を行ったとこ ろ、記録層に対して残留溶媒が1.7重量%存在すること が確認された。実施例1と同様にプリスター観察を行っ た結果、1cm×1cm四方に96個のプリスターが確 認された。また、剝離試験を行ったところ、反射膜と記 緑膜の間で剥離し、粘着テープとともに反射膜および保 護膜が剥がれてしまった。

#### [0017]

【発明の効果】以上説明した通り、本発明によれば、残 留溶媒盪度を規定することによりプリスターの発生を抑 え、かつ記録層と反射層の密着性のよい光記録媒体を提 供することが可能である。

# 【図面の簡単な説明】

.【図1】再生専用CDの断面図である。

【図2】 追記型CDの1例を示す断面図である。 【符号の説明】

- 1 基板
- 2 記録層

(5)

特開平4-369577

4 保護層

( <b>2</b> 1)	【図2】	
4	· .	
	·	<del></del> .
<del></del>		
4		
1		
	·	1
		•

- . .
- 3 反射机
- 4 43

- 1 54
- 3 ENN
- 4 688

フロントページの続き

(72) 発明者 浅見 球夫

神奈川県懐浜市柴区笠間町1190番地 三井 東圧化学株式会社内